

⑩ 日本国特許庁 (JP) ⑪ 特許出願公開
 ⑫ 公開特許公報 (A) 昭59-229553

⑬ Int. Cl.³
 G 03 C 1/68
 C 08 F 2/50
 G 03 C 1/00

識別記号 廷内整理番号
 7267-2H
 7102-4J
 7267-2H

⑭ 公開 昭和59年(1984)12月24日
 発明の数 1
 番査請求 有

(全 5 頁)

⑮ 光重合性組成物

⑯ 特 願 昭58-88024
 ⑰ 出 願 昭58(1983)5月18日
 ⑱ 発明者 角丸肇
 日立市東町四丁目13番1号日立
 化成工業株式会社茨城研究所内
 ⑲ 発明者 鍛治誠
 日立市東町四丁目13番1号日立

化成工業株式会社茨城研究所内
 ⑳ 発明者 林信行
 日立市東町四丁目13番1号日立
 化成工業株式会社茨城研究所内
 ㉑ 出願人 日立化成工業株式会社
 東京都新宿区西新宿2丁目1番
 1号
 ㉒ 代理人 弁理士 若林邦彦

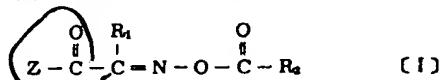
明細書

1. 発明の名称

光重合性組成物

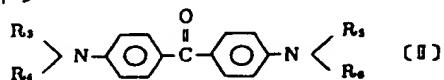
2. 特許請求の範囲

1.(1) 常圧において100℃以上の沸点を有し、
 有機溶剤に可溶な付加重合性化合物
 (2) 下記式〔I〕で表わされるオキシムエステル



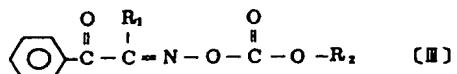
(式中, Zは置換または非置換のアリール基, R₁は水素または炭素数が3以下のアルキル基, R₂は炭素数が3以下のアルキル基, アリール基または炭素数が3以下のアルコキシ基である)

(3) 下記式〔II〕で表わされるアミノフェニルケトン



(式中, R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆はそれぞれ水素または炭素数が4以下のアルキル基である)
 を含有してなる光重合性組成物。

2. オキシムエステルが下記一般式〔III〕で表わされるオキシムエステルであり



(式中, R₁は水素または炭素数が3以下のアルキル基, R₂は炭素数が3以下のアルキル基, アリール基又は炭素数が3以下のアルコキシ基である), アミノフェニルケトンが4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノンまたは4,4'-ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノンである特許請求の範囲第1項の光重合性組成物。

3. 発明の詳細な説明

本発明は新規な光重合性組成物に関し、更に詳しくは新規な光開始剤系を含有する光重合性組成物に関する。

光重合性組成物は凸版用、レリーフ像用、フォトレジスト用等に広く用いられているが、その重合速度は、より速い系が望まれている。

従来より、この分野では重合速度を増大させる

特開昭59-229553(5)

合性組成物は、高い感度を有するものである。

代理人 弁理士 若林邦彦

